杭州远方光电信息股份有限公司 关于公司取得热阻分析方法美国发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到美国专利 商标局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称: METHOD FOR ANALYSIS OF THERMAL RESISTANCE (一种热阻分析 方法)

专利号: US 10,094,792B2

申请日期: 2013年12月24日

专利权人: 杭州远方光电信息股份有限公司

授权公告日: 2018年10月9日

专利权期限: 本专利的专利权期限为二十年, 自申请日起算。

本发明提供了一种热阻分析方法,通过建立被测对象的热传导数学模型,并 基于热源的关键数据和热学模型参量双向求解和分析热传导数学模型,可以准确 获取被测对象接触界面的热阻以及各热传导部件内部的热阻分布,实现被测对象 热阻结构的准确量化分析,全面评价被测对象内部的热接触状况,为LED、二极 管等各种器件的散热设计提供重要依据和评判手段,具有准确度高、速度快、适 用范围广等特点。

本发明专利在公司的产品中已有应用,经过长达近五年的审查后取得证书, 对公司基于专利进一步开发系列产品和开拓市场会产生积极的影响。

备查文件:《发明专利证书》

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十二日